

所有條文

法規名稱：放流水標準 [\[EN\]](#)

修正日期：民國 113 年 12 月 18 日

法規類別：行政 > 環境部 > 水質保護目

附檔：

- 附表一 晶圓製造及半導體製造業放流水水質項目及限值.PDF
- 附表二 光電材料及元件製造業放流水水質項目及限值.PDF
- 附表三 石油化學業放流水水質項目及限值.PDF
- 附表四 化工業放流水水質項目及限值.PDF
- 附表五 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業放流水水質項目及限值.PDF
- 附表六 發電廠放流水水質項目及限值.PDF
- 附表七 海水淡化廠放流水水質項目及限值.PDF
- 附表八 晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業、發電廠及海水淡化廠以外之事業放流水水質項目及限值.PDF
- 附表九 科學工業園區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值.PDF
- 附表十 石油化學專業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值.PDF
- 附表十一 其他工業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值.PDF
- 附表十二：社區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值 .PDF
- 附表十三：其他指定地區或場所專用污水下水道系統放流水水質項目及限值 .PDF
- 附表十四 公共污水下水道系統放流水水質項目及限值.PDF
- 附表十五 建築物污水處理設施放流水水質項目及限值.PDF
- 附表十六 .PDF

第 1 條 本標準依水污染防治法（以下簡稱本法）第七條第二項規定訂定之。

第 2 條 1 事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之放流水標準，其水質項目及限值之規定如下：

一、事業

（一）晶圓製造及半導體製造業適用附表一。

（二）光電材料及元件製造業適用附表二。

（三）石油化學業適用附表三。

（四）化工業適用附表四。

（五）金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業適用附表五。

(六) 發電廠適用附表六。

(七) 海水淡化廠適用附表七。

(八) 前七款以外之事業適用附表八。

二、污水下水道系統

(一) 科學工業園區專用污水下水道系統適用附表九。

(二) 石油化學專業區專用污水下水道系統適用附表十。

(三) 其他工業區專用污水下水道系統適用附表十一。

(四) 社區專用污水下水道系統適用附表十二。

(五) 其他指定地區或場所專用污水下水道系統適用附表十三。

(六) 公共污水下水道系統適用附表十四。

三、建築物污水處理設施適用附表十五。

- 2 事業、污水下水道系統排放廢（污）水於經直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區（以下稱總量管制區）內之特定承受水體者，其銅、鋅、總鉻、鎳、鎘、六價鉻之限值適用附表十六。但總量管制區內之事業或污水下水道系統，未排放廢（污）水於總量管制區內特定承受水體者，不適用附表十六規定。
- 3 特定業別、區域之事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施，另有排放標準者，或直轄市、縣（市）主管機關依據本法第七條第二項增訂或加嚴轄內之放流水標準者，依其規定。

第 2-1 條

- 1 工業區污水下水道系統，其石油化學業和化工業許可核准納管水量達許可核准排放量百分之五十以上者，適用附表十之規定；其石油化學業和化工業許可核准納管水量未達許可核准排放量百分之五十者，適用附表十一之規定。
- 2 海水淡化廠排放之廢（污）水適用之放流水標準依下列規定：
 - 一、以海水為原水，排放鹵水及過濾反洗廢水、薄膜清洗廢水或其他與海水淡化有關作業廢水混合排放者，適用附表七。
 - 二、產生之廢（污）水採海洋放流管線排放於海洋者，適用海洋放流管線放流水標準。

第 3 條

事業及其所屬公會或環境保護相關團體得隨時提出具體科學性數據、資料，供檢討修正之參考。

第 4 條 本標準所定之化學需氧量限值，係以重鉻酸鉀氧化方式檢測之；真色色度，係以真色色度法檢測之。

第 5 條 本標準用詞，定義如下：

一、總毒性有機物：指 1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、甲苯、乙苯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、二氯溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2-氯酚、2,4-二氯酚、4-硝基酚、五氯酚、2-硝基酚、酚、2,4,6-三氯酚、鄰苯二甲酸乙己酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯酯、蒽、1,2-二苯基聯胺、異佛爾酮、四氯化碳及萘，計三十種化合物之濃度總和。

二、石油化學業高含氮製程：指下列含氮製程，且作業廢水水量達放流口許可核准之排放水量百分之四十以上者：

(一) 三氟化氮與電子級液氮製造程序。

(二) 甲基丙烯酸酯類 (MMA) 化學製造程序。

(三) 丙烯腈製造程序。

(四) 丙烯腈-丁二烯共聚合物 (AB) 化學製造程序。

(五) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物 (ABS) 化學製造程序。

(六) 丙烯腈-苯乙烯共聚合物 (AS) 化學製造程序。

(七) 己內醯胺製造程序。

(八) 硫酸銨化學製造程序。

(九) 聚醯胺塑膠 (尼龍) 製造程序。

三、化工業高含氮製程：指下列含氮製程，且作業廢水水量達放流口許可核准之排放水量百分之四十以上之化工業者：

(一) 氮化學製造程序。

(二) 氮肥製造程序。

(三) 銨肥化學製造程序。

(四) 磷酸銨鹽肥料製造程序。

(五) 含氮複肥製造程序。

(六) 三氟化氮製造程序。

(七) 硫酸銨化學製造程序。

(八) 乙二胺四醋酸鹽 (EDTA) 化學製造程序。

(九) 其他銨鹽製造程序。

- (十) 丙烯腈製造程序。
- (十一) 尿素化學製造程序。
- (十二) 苯胺製造程序。
- (十三) 己內醯胺製造程序。
- (十四) 乙醇胺化學製造程序。
- (十五) 酸胺化學製造程序。
- (十六) 其他合成胺及腈合物製造程序。
- (十七) 甲基丙烯酸酯類 (MMA) 化學製造程序。
- (十八) 氨基甲酸酯製造程序。
- (十九) 尿素甲醛樹脂製造程序。
- (二十) 三聚氰胺樹脂製造程序。
- (二十一) 聚丙烯腈纖維製造程序。
- (二十二) 聚醯胺塑膠 (尼龍) 製造程序。
- (二十三) 丙烯腈－丁二烯共聚合物 (AB) 化學製造程序。
- (二十四) 丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚合物 (ABS) 化學製造程序。
- (二十五) 丙烯腈－苯乙烯共聚合物 (AS) 化學製造程序。
- (二十六) 染料製造程序 (偶氮染料)。
- (二十七) 煉焦相關程序，含焦碳製造之副產品程序、焦碳製造之蜂巢程序、流體焦碳製造程序、石油焦煉製程序等。

四、戴奧辛：指以檢測 2,3,7,8- 四氯戴奧辛 (2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzo-p-dioxin, 2,3,7,8-TeCDD)，2,3,7,8-四氯呋喃 (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran, 2,3,7,8-TeCDF) 及 2,3,7,8-氯化之五氯 (Penta-)，六氯 (Hexa-)，七氯 (Hepta-) 與八氯 (Octa-) 戴奧辛及呋喃等共十七項化合物所得濃度，乘以國際毒性當量因子 (International Toxicity Equivalency Factor, I-TEF) 之總和計算之，以總毒性當量 (Toxicity Equivalency Quantity of 2,3,7,8-tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin, TEQ) 表示。

五、總有機磷劑：指達馬松、美文松、滅賜松、普伏松、亞素靈、福瑞松、大滅松、托福松、大利松、大福松、二硫松、甲基巴拉松、亞特松、撲滅松、馬拉松、陶斯松、芬殺松、巴拉松、甲基溴磷松、賽達松、乙基溴磷松、滅大松、普硫松、愛殺松、三落

松、加芬松、一品松、裕必松、谷速松計二十九種化合物之濃度總和。

六、總氨基甲酸鹽：指滅必蝨、加保扶、納乃得、安丹、丁基滅必蝨、歐殺滅、得滅克、加保利、滅賜克計九種化合物之濃度總和。

七、除草劑：指丁基拉草、巴拉刈、二、四—地、拉草、全滅草、嘉磷塞、二刈計七種化合物之濃度總和。

八、七日平均值：指間隔每四至八小時採樣一次，每日共四個水樣，混合成一個水樣檢測分析，連續七日測值之算術平均。

第 6 條 本標準各項目限值，除氫離子濃度指數為一範圍外，均為最大限值，其單位如下：

一、氫離子濃度指數：無單位。

二、真色色度：無單位。

三、大腸桿菌群：每一百毫升水樣在濾膜上所產生之菌落數（CFU/100 mL）。

四、戴奧辛：皮克—國際—總毒性當量／公升（pg I-TEQ/L）。

五、其餘各項目：毫克／公升。

第 7 條 本標準各項目限值，除水溫及氫離子濃度指數外，事業或污水下水道系統自水體取水作為冷卻或循環用途之未接觸冷卻水，如排放於原取水區位之地面水體，不適用本標準。

第 8 條 1 事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施，同時依本標準適用範圍，有二種以上不同業別或同一業別有不同製程，其廢水混合處理及排放者，應符合各該業別之放流水標準。相同之管制項目有不同管制限值者，應符合較嚴之限值標準。各業別中之一種業別廢水水量達總廢水量百分之七十五以上，並裝設有獨立專用累計型水量計測設施者，得向主管機關申請對共同管制項目以該業別放流水標準管制。

2 前項廢水量所佔比例，以申請日前半年之紀錄計算之。

第 9 條 本標準除另定施行日期者外，自發布日施行。